

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成23年6月23日(2011.6.23)

【公表番号】特表2010-534358(P2010-534358A)

【公表日】平成22年11月4日(2010.11.4)

【年通号数】公開・登録公報2010-044

【出願番号】特願2010-518247(P2010-518247)

【国際特許分類】

G 03 F 7/42 (2006.01)

H 01 L 21/306 (2006.01)

H 01 L 21/308 (2006.01)

【F I】

G 03 F	7/42	
H 01 L	21/306	T
H 01 L	21/308	G

【手続補正書】

【提出日】平成23年5月6日(2011.5.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

イオン注入された領域を有する基材から汚染を除去するための方法であって、前記方法は、

メチルノナフルオロブチルエーテル、メチルノナフルオロイソブチルエーテル、エチルノナフルオロブチルエーテル、エチルノナフルオロイソブチルエーテル、3-エトキシ-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-ドデカフルオロ-2-トリフルオロメチル-ヘキサン、1,1,1,2,3,3-ヘキサフルオロ-4-(1,1,2,3,3,3-ヘキサフルオロ-プロポキシ)-ペンタン、1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-デカフルオロ-3-メトキシ-4-(トリフルオロメチル)-ペンタン、及び1,1,2,2-テトラフルオロ-1-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-エタンのうちの少なくとも1つから所望により選択されるフッ素化溶媒と、

1-メトキシ-2-プロパノール、エチレングリコールジアセテート、1,2-プロパンジオールモノメチルエーテルアセテート、又はジプロピレングリコールモノメチルエーテルのうちの少なくとも1つから所望により選択される共溶媒とを含む組成物を、前記基材からの前記汚染の除去を助けるのに十分な量で、前記基材に適用する工程を含む、方法。

【請求項2】

前記組成物は、共沸混合物又は共沸様組成物である、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

請求項1の方法によって処理された物品。

【請求項4】

少なくとも一部がフォトレジストで被覆された基材を提供する工程と、

前記フォトレジストで被覆された前記基材の少なくとも一部にイオンを注入して、イオン注入された領域及びイオンを注入された前記フォトレジストの少なくとも一部を有する基材を得る工程と、

イオンを注入された前記フォトレジストの少なくとも一部をフッ素化溶媒と共に溶媒とを含む組成物を用いて除去する工程と、を含み、

前記基材上に金属又は合金を堆積させる工程、イオン注入された領域及びイオンを注入された前記フォトレジストの少なくとも一部を有する前記基材を少なくとも部分的に灰化する工程、及びイオンを注入された前記フォトレジストの少なくとも一部を除去する工程の後に、前記基材上に配線層を提供する工程のうちの少なくとも1つの工程を所望により更に含み、

前記配線層が、絶縁材料と金属配線とを含む、プロセス。